



バンドギャップエネルギーより小さな可視発光



Energy dd 励起 Ti 3 $d e_q$ • 結晶場励起によるピーク E_{F} Ti 3*d* t_{2q} 分裂した d 軌道間での遷移 O 2*p* d^oではないことの証拠 Ω • *dd* 励起に注目し, *d* 電子の変化を観測 Ti 2*p* 測定 @ PF BL-2C Sample Sample UV Laser **UV** Laser θ UV laser 325 nm, 10 mW 70 K, RT Temp. $E/\Delta E$ 0.7 eV (a) *E*_{in} // [100] 試料 (b) *E*_{in} // [110] 試料

Results & Discussion

5% La-doped STO Ti L SXES





STO Ti L XAS

- スピン軌道相互作用による L_2 , L_3
- 結晶場により分裂した t_{2q}, e_q (10Dq = 2.3 eV)
- SXES の励起エネルギーを決定



- *e*_qへの共鳴に伴い弾性散乱直下に *dd*
- *E*_{dd} = 2.7 eV (10*Dq* に相当)



UV 照射下 STO Ti L SXES

- d⁰系の STO に UV 照射
 - ➡ dd ピーク出現
- ピーク位置はキャリアドープ系と同じ
- キャリアドープ系より強度が弱い。



UV 照射下 dd ピークの時間変化











- UV 照射下 ARPES 測定
- UV 照射の時間経過に伴い dd ピークが出現
- *dd* 強度は時定数 τ = 47 min. で増加
- その後 dd ピークは UV-off でも存在 ➡ 不可逆
- O 2p バンド (B, C) が高結合エネルギー側に 不可逆なシフト[右図]
- UV が STO 表面の再構成を誘起
- 可視発光は酸素欠損による伝導性が起因

Conclusion

☆ これまで見られなかった UV 照射に対する不可逆な dd ピークを観測

◆ SRとUVを同時照射することで表面に損傷が生じる ⇒ d¹ 電子状態を形成

◆ 可視発光現象は dd 励起との関係性がみられない → 発光は結晶自身の内因的な現象

電場印加によるキャリア注入下で XES 測定を行い

さらなる STO の物性理解をすすめる